PAT-NO:

JP356113470A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 56113470 A

TITLE:

MANUFACTURE OF INK JET HEAD

PUBN-DATE:

September 7, 1981

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

UEISHI, YUKIHIRO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

RICOH CO LTD

N/A

APPL-NO:

JP55017577

APPL-DATE: February 15, 1980

INT-CL (IPC): B41J003/04, B05B001/02, G01D015/18

US-CL-CURRENT: 29/890.1

ABSTRACT:

PURPOSE: To improve the reliability of an ink jet head and increase printing accuracy by a method wherein glass paste with the low melting point is printed on a multinozzle plate consisting of a silicon monocrystal in a screen shape, the paste is melted and the multinozzle plate and liquid-chamber structures are connected.

CONSTITUTION: The surfaces of a multinozzle plate 1, in which a silicon monocrystal wafer is photoetched in an anisotropic shape and a plurality of nozzles 2 are made up, and glassy liquid-chamber struutures 3 are grease-removed, washed and dried. Glass paste 5 with the low melting point is printed on a connecting surface of the multinozzle plate in a screen shape in beltlike patterns surrounding each nozzle. The glass paste printed is dried for 15min at 125°C, and a solvent section is previously evaporated. The liquid-chamber structures and the multinozzle plate are stacked, baked (for 15∼30min at 380∼450°C), and connected.

COPYRIGHT: (C)1981,JPO&Japio

Lat Available Copy

19 日本国特許庁 (JP)

① 特許出願公開

⑫ 公開特許公報 (A)

昭56—113470

⑤ Int. Cl.³
 B 41 J 3/04
 B 05 B 1/02
 # G 01 D 15/18

識別記号 103 庁内整理番号 7231-2C 7112-4F 6336-2F ❸公開 昭和56年(1981)9月7日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

匈インクジェットヘッドの製造方法。

願 昭55-17577

22出 煎

0)特

額 昭55(1980)2月15日

②発 明 者

上石幸拓

東京都大田区中馬込1丁目3番

6号株式会社リコー内

の出 願 人 株式会社リコー

東京都大田区中馬込1丁目3番

6号

個代 理 人 弁理士 星野恒司

外1名

別 細

1. 発明の名称 インクジェットヘッドの製造方法

2. 特許請求の範囲

3. 発明の詳細な説明・

本発明は、インクジェット 記録装置における改 良されたベルチノメルインクジェットヘッドの製 造方法に関するものである。

従来、この種の装置は、複数のノメルを配設ししたマルチノメル版とインクに振動を与えるための振動子を有する液塞を設けた液塞構造体とを接動し、前記複数のノメルからインク商を吹射るのでが出し、がからになりでないとインク商の大きさや喰射方向にはらつきが生じ、記録品質を著しく低下させる。

これに対し、シリコン単結晶ウェーハを異力性ホトエッチングして均一なノズルを形成するようにしたマルチノズル板が知られている(例えば、特開昭 51-87924 号公報総照)。このマルチノズル板は、結晶の(100)面が表面に平行に配向するように切り出されたシリコンウェールと水と合はエチレンジアミンと使用して孔あけるとうにな異方性エッチング被を使用して孔あけるとうに、外での孔が形成され、各ノズルの形状や寸次が均一になるという特徴がある。そしてこのマルチ

- 1 -

inst Available Copy

特開昭56-113470 (2)

ノズル 仮と液 盆 構造体とをエポキシ樹脂の如き有機物 接 希剤を用いて接 雅したインクジェットヘッドが 想象されている。

しかしながら、マルチノズル板と液室構造体とを有機物接附剤で接合した場合、インク液が一般にアルカリ水溶液(pH ≈ 10)であるため時間の経過とともに接射剤を彫過させ、接合部が劣化するので信頼性が極めて低い。

また、シリッンの熱膨張係数が略 4.2×10⁻⁶/C であるのに対し、エボキン樹脂のそれは 30×10⁻⁶ ~ 65×10⁻⁶/C と 1 桁の差があり、さらに大きい熱膨低係数を有する金属の液室構造体に接合すると、使用状態で加わるヒートサイクルによって接合部に応力がかかり、次第に劣化して接合部にクラックが入ったり、ついにはシリコン単結晶のマルチノズル板を依拠するに至る。

この 無 膨 張 係 数 の 差 に よ る 接 合 部 や マ ル チ ノ ズ ル 板 の 破 壊 は 、 マ ル チ ノ ズ ル 板 の 面 積 が 通 常 の 半 導 体 素 子 に 比 較 し て 非 常 に 大 き い の で 、 半 導 体 素 子 の ダ ィ ボ ン デ ィ ン グ に 用 い ら れ る 共 晶 合 金 や は

- 3 -

において然膨胀係数の差による応力がかかり、マルチノズル板を破壊することがある。

本党明は、上記が、 とのでは、 というには、 といいいは、 といいいは、 といいは、 とい

接合工程を描述すると、まず、マルチノズル板 1と被室構造体3の表面を脱脂洗浄して乾燥する。 次に、・ルチノズル板1の接合面に各ノズル2を んだのろう付けによる接合でも同様に発生する。 実験の結果、シリコンの無膨張係数と結合材また は液室構造体のそれとの差が 5×10⁻⁶/C 以上ある とクラック等が発生することが判明した。

さらに、有機物接着利は硬化促進のために硬化、
剤が添加されているので常温においても硬化が逃
み、そのため作業性が悪く、量産性に劣る。また、
有機物接着剤は加熱硬化の過程において洗動し場
く、ノズル部に流れて目づまりが発生したり、接着剤の厚さにはらつきを生じ、液室構造体とノズル板との平行度が損なわれる等の欠点があった。

以上のことから、シリコン単結晶のマルチノス
ル板を使用する場合は、液室構造体と接合材材
質を、特に無膨張係数と耐薬品はを考慮して必が
することが極めて重要である。あわせて、シリッ
と単結晶のマルチノメル板と対流室構造のでは、シリッ
において、部分または全体にかかわらず高温がか
な接合はシリコンの結晶構造を変え、機械的強症を
低下させるとともに、高温から常温への冷却過程

- 4 -

取り巻くような帯状のバターンで、低触点ガラスベースト 5 (例えば、 ESL 社製のシーリングガラスベースト 4 4017)をスクリーン印刷する。印刷した低融点ガラスベースト 5 は 125 で・15 分の乾燥で溶剤分を予め蒸発させる。続いて、第2 図のように、液室構造体 3 とマルチノズル板 1 とを重ねて焼成 (380 ~ 450で・15~30分)し、接合する。

Best Available Copy

特開昭56-113470 (3)

るとともに、印刷したパターンは略その形状を維持してお除するので各ノメル2の周囲における接付状態が一般になり、マルチノメル板1と液室構造体3との平行度も保たれ、インクの噴射特性が均一になる等の効果がある。

なお、本実施例では、低融点ガラスペーストをマルチノメル板に印刷したが、液室構造体の側に印刷してもよい。また、液室構造体の材質としてステアタイトやアルミナ等の磁器(熱彫張係数6×10⁻⁶~7×10⁻⁶/C)、コパール合金(熱膨張係数4.7×10⁻⁶/C)などを使用してもよい。

以上説明したように、本発明によれば、シリコン単結晶のマルチノメル板または液室構造体のいかけれか一方に低融点ガラスペーストをスクリーン印刷し、これを溶験してマルチノメル板と液室構造体とを接合することにより、マルチノメルインクジェットヘッドの信頼性を向上するとともに、

4. 図面の簡単な説明

第1図および第2図は本発明の1実施例の構成

- 7 -

を示す図で、第1図はマルチノズル板の接合面を示す図、第2図はインクジェットヘッドの部分の 断面図である。

1 …… マルチノズル板、 2 …… ノズル、

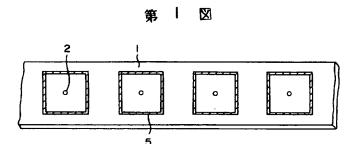
3 …… 液室構造体、 4 …… 液室、

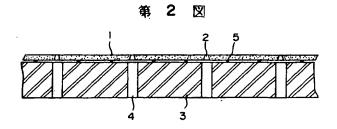
5 …… 低触点ガラスベースト。

特許出願人 株式会社 リ コ -

代理人 星野 恒 司

给 木 和 夫





- 8 -